

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020, ώρα 9:30, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του

Γιώργου Χλιαβώρα

Computational study and development of a kinetic model for the moderate temperature, atmospheric pressure chemical vapor deposition of SiO₂ films from the TEOS/O₃/O₂ chemical system*

Εξεταστική Επιτροπή: Α. Γ. Μπουντουβής, C. Vahlas, Π. Βασιλείου

*Εκπονήθηκε σε συνεργασία με Université de Toulouse, Γαλλία